PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-121152

(43) Date of publication of application: 08.05.2001

(51)Int.CI.

C02F 1/469 B01D 61/48 C02F 1/42

(21)Application number: 11-308435

(71)Applicant: EBARA CORP

(22)Date of filing:

29.10.1999

(72)Inventor: AKAHORI SHOJI

KAWAMOTO TAKAYOSHI

NAKANISHI OSAMU

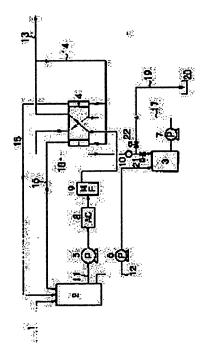
MIURA SHINJI AKIYAMA TORU

(54) ELECTRIC DESALTING APPARATUS

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an electric desalting apparatus efficiently performing desalting treatment for raw water containing fluoric acid or high concentration of chlorine ions without incuring troubles such as deterioration/damages of an ion exchange membrane and an ion exchange body caused by corrosion of the electrode and generation of free chlorine.

SOLUTION: This electric desalting apparatus is provided with a desalting room and a concentration room tormed by alternatively arranging at least respective portions of a cation ion exchange membrane and an anion exchange membrane between positive and negative electrode rooms, and ion at least the desalting room is



tilled with ion exchange bodies, and treated water from the desalting room is used as feed water to the electrode room.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

04.09.2003

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(J P)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出慮公開發号

特開2001-121152

(P2001 - 121152A)

(43)公陽日 平成13年5月8日(2001.5.8)

(51) Int.CL'		織別配号	ΡI		÷	f-73-/*(参考)
C02F	1/469		BOID	61/48		4D006
B01D	61/48		C02F	1/42	E	4D025
C02P	1/42			1/46	103	4D061

審査請求 京請求 菌求項の数3 OL (全 6 页)

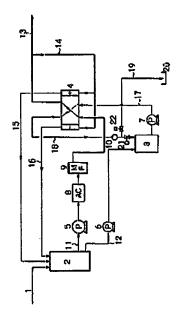
(21)出蘇番号	物顧平11-308435	(71)出顧人	000000239
			株式会社程原製作所
(22)出験日	平成11年10月29日(1999.10.29)		東京都大田区羽田旭町11番1号
		(72)発明者	赤堀 晶二
			東京都大田区羽田旭町11番1号 株式会社
			硅
		(72)発明者	川本 孝曽
			東京都大田区羽田旭町11番1号 株式会社
			准
		(74)代壁人	100089705
		į	弁理士 礼本 一夫 (外5名)
			最終質に続く

(54) 【発明の名称】 電気式脱塩装置

(57)【要約】

【課題】 ファ酸や高濃度の塩素イオンを含む原水を、 電極の腐食や遊離塩素の発生に起因するイオン交換膜及 びイオン交換体の劣化/破損といった問題を引き起こす ことなく、有効に脱塩処理を行うことができる電気式脱 塩装置を提供する。

【解決手段】 本発明に係る電気式脱塩装置は、正負の両電極室間に、陽イオン交換膜及び除イオン交換膜を少なくとも一部交互に配列することによって脱塩室と濃縮室とが形成されており、少なくとも脱塩室にはイオン交換体が充填されており、電極室への供給水として脱塩室からの処理水を使用することを特徴とするものである。



(2)

【特許請求の範囲】

【請求項1】 正負の両電極室間に、陽イオン交換膜及び除イオン交換膜を少なくとも一部交互に配列することによって脱塩室と濃縮室とが形成されており、少なくとも脱塩室にはイオン交換体が充填されている電気式脱塩 装置であって、電極室への供給水として脱塩室からの処理水を使用することを特徴とする電気式脱塩等置。

1

【請求項2】 電極室にイオン交換体が充填されている 請求項1 に記載の電気式脱塩装置。

[語求項3] 陽極空に陽イオン交換体が、陰極室に陰 10 イオン交換体が充塡されている請求項2に記載の電気式 80位4程

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、例えば半導体デバイス製造工程、ウエハー製造工程などにおけるウエット 洗浄工程で使用された純水を回収・再利用するのに用いるととのできる電気式脱塩鉄圏に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、環境保護のために水の有効利用が 20 進められており、半導体デバイス製造工程、ウエハー製 造工程、液晶洗浄工程などのウェットプロセスにおい て、洗浄等に用いられる糖水を回収再利用するシステム が採用されてきている。このシステムを採用することに より、原水の使用畳と緋水量の両方の削減が可能にな り、環境保全及び環境汚染の低減化が進められてきた。 しかしながら、特に半導体デバイス製造工程のウエット プロセスにおいては、硫酸、アンモニア、塩酸、ファ 酸、過酸化水素等の薬品が使用されており、その排水は pH2~4の希薄酸性水であるが、この希薄酸性水を、 地下水、工業用水、水道水などの供給原水に合流させて 超純水製造系に再使用する場合、フッ酸とカルシウムと が反応して不溶性のフッ化カルシウム塩が生成され、こ れが純水製造装置に有害な影響を与える。この為に、排 水中のフッ酸の過度をlmg/!未満程度に低減させる 必要が生じていた。

【0003】希薄融性水の回収・再利用においては、回収原水をアニオン交換制脂で処理してファ酸を除去した後に、供給原水と台流させて、逆浸透膜によって第1次の射塩処理を行い、次にイオン交換樹脂によって超純水 40の原料である一次純水を製造してきた。このイオン交換樹脂は、イオンの飽和型吸着剤のために、一旦敵和すると薬品によって再生しなければならず、薬品の排水処理プロセスが必要となり、排水処理の負荷の一部となっていた。近年、イオン交換樹脂法に代わる方法として、イオン交換膜を利用した電極反応による電気式脱塩装置の利用が進み始めてきている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記の びに、本発明者らが国際特許出順PCT/JP99/0 方法は、いずれも、逆浸退膜の衰菌でファ酸と硬度成分 50 1391において提案したイオン伝導性を持たせたスペ

とが反応して不溶性の塩が生成されないように、第1段階のアニオン交換制脂によってフッ酸を確実に除去する必要がある。また、これらの方法においては、少なくとも、アニオン交換制脂核菌、逆浸透膜装置、及びイオン交換制脂核量又は電気式隔塩核量の3つの核量が必要となり、設備投資と運転コストの増大を招くと共に運転管理が複雑化していた。

【0005】かかる問題を排除する方法として、回収原水である希荷酸性水を、実質的に電気式脱塩装置単独で直接処理することが望まれているが、回収原水中に含まれるファ酸によって電気式脱塩装置の電極が激しく腐食するという問題が発生し、実用化には至っていない。【0006】一般に、電極板の材料としては、チタン等の下地金属基材に白金メッキが施されたものが広く用いられている。白金はファ酸に対して耐食性を有するが、メッキは下地材料を完璧に核寝することが難しく、極後小なビンホールが発生する。このビンホールからファ酸が入り込み、下地の金属材料を腐食させることが問題であった。

20 【0007】また、彼処理水の塩素イオン濃度が高い場合には、彼処理水を陽極室に通水すると陽極での電極反応によって遊離塩素が発生する。この遊離塩素は、イオン交換膜及びイオン交換体に酸化作用を及ぼし、陽極室のイオン交換機及び充填したイオン交換体の低寿命化、ひいては損傷を与えることがあり、問題となっていた。 【0008】したがって、本発明の目的は、電気式脱塩装置の彼処理水中にフッ酸が含まれる場合や、候処理水が高塩濃度の場合においても、上記のような問題を発生させることなく、有効に脱塩処理を行うことができる電の気式脱塩装置を提供することにある。

[0009]

【課題を解決するための手段】 本発明は、正負の両電極室間に、陽イオン交換膜及び除イオン交換膜を少なくとも一部交互に配列することによって脱塩室と濃縮室とが形成されており、少なくとも脱塩室にはイオン交換体が充填されている電気式脱塩装置であって、電極室への供給水として脱塩室からの処理水を使用することを特徴とする電気式脱塩装置に関する。

[10110] とのように、電極室への供給水として、脱塩室からの処理水(脱塩水)を使用することにより、電極室へは、ファ酸や塩イオンが低減された液が供給されるので、ファ酸による電極の腐食や、陽極室における遊離塩素の発生に起因するイオン交換機の損傷等の問題が解決される。

【0011】本発明に係る電気式脱塩装置においては、少なくとも脱塩室、及び好ましくは遺稿室に、イオン交換体が充填される。本発明においていう「イオン交換体」とは、陽イオン交換機能及び降イオン交換機能、並びに、本発明者らが国際特許出類PCT/JP99/01391において根率したイオン伝導性を徐たせたスペ

ーサー(イオン伝導スペーサー)が包含される。これら のイオン交換体を、脱塩室及び好ましくは濃縮室に充填 することにより、各室内でのイオンの移動がより遠やか になり、運転電圧の低減化及び脱塩効率の向上を達成す るととができる。

【0012】イオン交換機能を脱塩室及び好ましくは濃 縮室内に配置する場合は、陽イオン交換膜に隣接して陽 イオン交換繊維を、陰イオン交換膜に隣接して陰イオン 交換微維をそれぞれ配置する。

くは澁浦室内に配置する場合は、1枚でもよいし、複数 枚装填してもよいが、イオン交換機能の異なる陽イオン 伝導スペーサーと陰イオン伝導スペーサーとを任意に組 み合わせて配置することができる。彼処理水の水質に応 じて組合せを選択することにより、種々の性能の脱塩装 置を形成することができる。例えば、脱塩室内に、陰イ オン交換繊維に隣接して除イオン伝導スペーサー 陽イ オン交換繊維に隣接して陽イオン伝導スペーサーを配置 することができる。なお、陽イオン伝導スペーサーのみ を1枚又は複数枚脱塩室内に組み込む場合が最も低電圧 20 化が図れ、また、陰イオン伝導スペーサーのみを 1 枚又 は複数枚脱塩室内に組み込むと、シリカ、炭酸、TOC を含む陰イオンの除去性能が向上することが分かってい る。しかしながら、なぜこのような組合せを採用した場 台に低電圧化や陰イオン除去性能の向上が得られるか は、理論的に解明されていない。なお、脱塩室内には腸 イオン交換体と除イオン交換体とが配置されるので、必 ず異種のイオン交換体が接触する部所が生じ、この接触 部所を中心に水の解離が起とり、生じた水の解離によ

【①①14】濃縮室の電気抵抗を低減させ、更にイオン 交換膜面のイオン濃度の上昇を抑制するためには、濃縮 室内にもイオン伝導スペーサーを装填することが望まし い。との場合、陽イオン伝導スペーサー、陰イオン伝導 スペーサーのいずれも適用可能であるが、陽イオン交換 膜面の陽イオン遺度の上昇の抑制を目的とする場合には **寝イオン伝導スペーサーを配置することが好ましいし、** 陰イオン交換膜面の陰イオン濃度の上昇の抑制を目的と する場合には陰イオン伝導スペーサーを配置することが 40 の性能を発揮することができなくなる可能性があるから 好ましい。

【0015】本発明においてイオン交換体として用いる ことのできるイオン伝導スペーサーとしては、ポリオレ フィン系高分子製樹脂、例えば、従来電気透析槽におい て使用されていたポリエチレン製の斜交網(ネット)を 基材として、これに、放射線グラフト法を用いてイオン 交換機能を付与したものが、イオン伝導性に優れ、彼処 選水の分散性に優れているので、好ましい。

【りり16】スペーサーの墓材としては、ポリオレフィ ン系高分子、例えばポリエチレンやポリプロピレンが夢 50 【①020】本発明の電気式脱塩装置において 脱塩室

げられるが、本発明においては、放射線グラフト重台が 容易なポリエチレンを用いるのが好ましい。

【0017】スペーサー基村に導入するイオン交換基と しては、特に限定されることなく種々の鴨イオン交換基 又は陰イオン交換基を用いることができる。例えば、陽 イオン交換体としては、スルホン酸基。カルボキンル 基。リン酸基。フェノール性水酸基などの陽イオン交換 基含有体、陰イオン交換体としては、第1級~第3級ア ミノ基、第4アンモニウム基などの除イオン交換基含有 【① ① 1 3】 イオン伝導スペーサーを脱塩室及び好まし 10 体を用いることができ、或いは、上記陽イオン交換基及 び陰イオン交換基の両方を併有するイオン交換体を用い るとともできる。

【①①18】本発明に係る電気式脱塩装置において用い るスペーサー芸材にグラフト重合する重合性単量体(モ ノマー)としては、イオン交換基を有するか、又はイオ ン交換基に転換可能な基を有するものを用いるととがで きる。例えば、イオン交換器を有するモノマーとして、 アクリル酸(AAc)、メタクリル酸、スチレンスルボ ン酸ナトリウム (SSS)、 メタクリルスルホン酸ナト リウム、アクリルスルボン酸ナトリウム、ビニルベンジ ルトリメチルアンモニウムクロライド (VBTAC) な どを用いて放射線グラフト重合を行うことにより、基材 に直接イオン交換基を導入することができる。また、イ オン交換基に転換可能な墓を有するモノマーとしては、 アクリロニトリル、アクロレイン、ビニルピリジン、ス チレン、クロロメチルスチレン、メタクリル酸グリシジ ル(GMA)などが挙げられる。例えば、メタクリル酸 グリンジルを放射線グラフト重合によって基材に導入 し、次に亜硫酸ナトリウムなどのスルホン化剤を反応さ り、脱塩室の中のイオン交換体が再生されると考えられ、30、せることによってスルホン酸基を導入したり、又はジエ タノールアミンなどを用いてアミノ化することなどによ って、イオン伝導スペーサーを得ることができる。

【0019】なお、陽イオン交換基を導入する場合には 少なくともスルホン酸基、陰イオン交換基を導入する場 台には少なくとも第4アンモニウム基を導入することが 好ましい。これは、絶水製造の用途の場合には、処理水 のpHが中性領域であり、したがって存在するイオン交 換基がこの領域でも解離しているスルホン酸基や第4ア ンモニウム基でなければ電圧が高くなってしまい。 所定 である。もちろん、弱酸性の陽イオン交換基であるカル ボキンル基、弱塩基性の陰イオン交換基である第3級ア ミノ墓や、より低級のアミノ基がスペーサーに同時に存 在していてもよいが、スルホン酸基及び第4 アンモニウ ム基が、それぞれ中性塩分解容量として0.5~2.0 meq/gの量で存在することが好ましい。なお、イオ ン交換容量はグラフト率を変化させることによって増減 させることができ、グラフト率が大きい程、イオン交換 容量が大きくなる。

及び好ましくは造縮室中に充填するスペーサーの形状と しては、斜交線が適している。スペーサーの具備すべき 条件として、接処理水が乱流を起こしながら分散して流 れ易いこと、スペーサーとイオン交換微維とが十分に密 君することができること、溶出物や粒子の発生が少ない こと、圧力損失が小さいこと、イオン交換繊維の変形や 圧密化が起こらないよう機能に密着すること、などが挙

【りり21】一般に、脱塩室で処理された液を電極室へ の供給水として使用すると、イオン造度が極めて低い液 10 縮水配管17を通して、電気式脱塩装置4の濃縮室に供 が極水として用いられることになるので、印加電流に対 して高い抵抗体が存在することになり、電極間の電圧が 非常に高くなるという問題が生じる。この問題を解決す るためには、上記に説明したようなイオン交換体、特 に、イオン伝導スペーサーを弯極室に配置することがで きる。このようにすると、イオン濃度が極めて低い水溶 液中でも、イオン伝導スペーサーが存在している部分の イオン伝導性が向上して、あたかもイオン濃度が高くな った状態と同等の電気抵抗になり、電流が流れ易く低電 圧運転が可能になる。本発明において、電極室にイオン 伝道スペーサーを配置する場合には、一般に、陽極室に 陽イオン伝導スペーサーを、陰極室に陰イオン伝導スペ ーサーを充填することが好ましい。

【0022】なお、電極間に陽イオン交換膜と陰イオン 交換機とを少なくとも一部交互に配列することにより脱 塩室と濃縮室とを形成した電気式脱塩装置においては、 極室として、遺稿室の機能を有するものと脱塩室の機能 を有するものの両方のタイプがある。しかしながら、本 発明に係る脱塩装置においては、極室中の水溶液のファ 酸や塩の濃度を低く抑えることが主眼となっているの で、極室は、脱塩室の機能を有していなければならな い。極空が濃縮室の機能を有していると、極空に導入す る水溶液として、フッ酸及び塩濃度の低い脱塩室の処理 水を用いても、装置の運転中にこれらのイオンがイオン 交換膜を通って極室内に侵入してくるので、フッ酸によ る電極の腐食や遊離塩素の発生によるイオン交換機の劣 化などの問題が選けられない。

[0023]

【発明の真施の形態】本発明の真施の形態について、図 面を用いて説明する。図1は、本発明に係る電気式脱塩 接置を用いた神水製造工程の一感線を示すプロック線図 である。

【りり24】ウエット洗浄工程からの排水(回収原水)※

*は、原水タンク2に貯槽され、彼処理水配管11を通し て、送水ポンプ5によって、活性炭カートリッジ8及び フィルタ9を経由して、電気式脱塩装置4の脱塩室に供 給される。必要に応じて、電気式脱塩装置4の前段に、 脱気装置(図示せず)を配置することができる。

【①025】電気式脱塩装置の濃縮室への供給水として は、原水タンク2から送水ポンプ6によって濃縮水循環 タンク3に送られた回収原水を使用する。 濃縮水タンク 3に貯槽された回収原水は、送水ボンブ7によって、濃 給される。濃縮室からの出口水(濃縮水)は、遺稲室緋 水配管18を通して、濃縮水循環タンク3に循環する。 好ましくは、遺稿室排水配管18に導電率計10を設置 して、濃縮水の導電率を測定することによって、濃縮水 のイオン濃度をモニターする。濃縮水のイオン濃度が一 定レベルを超えたら、バルブ22を開放して、遺稿水緋 水配管19を通して、緋水溝20へ排水する。通常は、 議稿水の導電率が2~4 m S/mを超えたらパルプ22 を開放して排水するようにすることが好ましい。 このよ 20 うに造縮水のイオン濃度をモニターしながら循環させる ことによって、廃棄される排水の畳を低減することが可 能になる。なお、この排水による循環の減量分は、送水 ボンブ6によって原水1を遺縮水循環タンク3に補給す ることによって捕填される。

【0026】電気式脱塩装置4の両電極室には、脱塩室 からの出口水(脱塩水)の一部が供給される。とれば、 脱塩室出口配管 13から電極水供給配管 14を分岐して 電便室に接続することによって行われる。それぞれの電 極室からの出口水は、陽極室出口配管15及び陰極室出 30 口配管16を通して、原水タンク2に戻される。なお、 必要に応じて、陽極室出口配管15及び陰極出口配管1 6には、空気抜き弁(図示せず)を配置することができ

[0027]

【実施例】イオン交換不像布及びイオン伝導スペーサー の製造

表した。本真能例においてイオン交換不識布の製造に使 用した基材不徹布の仕様を示す。この不確布は、芯がボ リプロピレン。鞘がボリエチレンから構成される複合繊 継を熱融者によって不織布にしたものである。

[0028]

【表1】

	-
芯斯成分	お:ポリプロピレン/鞘:ポリエチレン
目付	50g/m²
厚さ	0. 55mm
凝維径	15~40μm
不稳布极法	熱敵增选
空隙率	91%

【0029】表2に、本実施例においてイオン伝導スペ 50 ーサーの製造に使用した基材料交網の仕様を示す。

特闘2001-121152

(5)

【0030】 【表2】

表 2

成分	「ポリエテレン
形状	斜交網
厚さ	0.8mm
日開き	6 mm×3 mm

【0031】表1に示した不緻布に、ガンマ線を、窒素 雰囲気下で照射した後、メタクリル酸グリシジル(GM A)溶液に浸漉して反応させ、グラフト率163%を得 10 た。次に、このグラフト処理済不織布を、亜硫酸ナトリ ウムノイソプロビルアルコールノ水の混合液中に浸漉し て反応させ、スルホン化を行った。得られたイオン交換 不橡布のイオン交換容置を測定したところ、中性塩分解 容量が2.82meq/8の強酸性陽イオン交換不檢布 が得られたことが分かった。

【0032】一方、上記のようにガンマ線を照射した不 織布を、クロロメチルスチレン(CMS)溶液に浸漬し て反応させたところ、148%のグラフト率が得られ た。このグラフト処理済不機布を、トリメチルアミン1 20 0%水溶液中に浸漬して反応させ、4級アンモニウム化 を行った。得られたイオン交換不織布は、中性塩分解容 置が2、49meq/gの強塩基性除イオン交換不織布 であった。

【0033】表2に示した斜交網基材に、N,雰囲気下でガンマ線を照射した後、メタクリル酸グリシジル(GMA)/ジメチルホルムアミド(DMF)の複合液中に浸渍して反応させ、グラフト率53%を得た。このグラフト処理済ネットを、亜硫酸ナトリウム/イソプロビルアルコール/水の複合液に浸漬して反応させてスルホン30化を行ったところ、中性塩分解容質が0.62meq/gの強酸性陽イオン伝導スペーサーが得られた。

[0034]表2に示す斜交網基材に上記と同様の照射を行い、ビニルベンジルトリメチルアンモニウムクロライド(VBTAC)/ジメチルアクリルアミド(DMAA)/水の混合液中に浸渍して反応させてグラフト率36%を得た。このスペーサーは、中性塩分解容量が0.44meq/gの強塩基性除イオン伝導スペーサーであった。

真越倒1

上記で得られたイオン交換不織布及びイオン伝導スペー サー並びに市販のイオン交換膜を用いて、電気式脱塩装 置を形成した。陽イオン交換膜として株式会社トクヤマ 製の陽イオン交換膜(商品名:C66-10F)を、陰 イオン交換膜として株式会社トクヤマ製の陰イオン交換 膜(商品名:AMH)をそれぞれ用い、脱塩室のセルを 11個並列に有する電気式脱塩装置を形成した。 脱塩室 においては、陽イオン交換膜に隣接して上記で得られた 隠イオン交換不徹布を、除イオン交換膜に隣接して上記 で得られた陰イオン交換不徹布を充填し、更に、上記で 得られた陽イオン伝導スペーサーを陽イオン交換不織布 側に、陰イオン伝導スペーサーを陰イオン交換不線布側 に、それぞれ1枚ずつ装填した。濃縮室内には、イオン 伝導性を付与していない未処理のポリエチレン製料交網 を1枚装填した。電極室においては、陽極室に上記で得 られた陽イオン伝導スペーサーを、除極度に上記で得ら れた陰イオン伝導スペーサーをそれぞれ1枚装填した。 【0035】との装置を用いて、フッ酸濃度が0.7~ 0.8mg/1の溶液を、流量1m³/hrで2時間通 水したところ。処理水(脱塩室出口水)の比抵抗は15 MΩ・cm以上が確保された。また、電圧は280V以 下、消費電力は150~250W・hr/m'であっ た。道水試験の後に電極の腐食並びにイオン交換機及び

がなかった。 【0036】

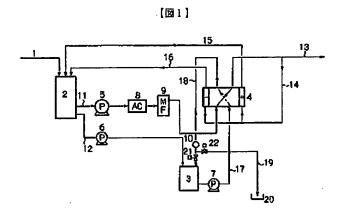
【発明の効果】本発明に係る電気式脱塩装置によれば、電極室への供給水として、塩イオン遺度及びフッ酸濃度が大きく低減された脱塩室からの処理水を用いているので、フッ酸による電極の腐食及び陽極室における遊離塩蒸発生に起因するイオン交換膜及びイオン交換体の劣化/損傷という問題を引き起とすことなく、フッ酸や各種塩を含む半導体デバイス製造工程などのウェット洗浄工程からの回収原水をそのまま処理して、各種イオン及びフッ酸が除去された洗浄工程に再利用可能な純水を得ることができる。

イオン交換体の劣化の状態を調べたが、実用上全く問題

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明に係る電気式脱塩装置の構成を示すプロック模図である。

40



フロントページの続き

F ターム(参考) 4D006 GA17 HA47 JA04C JA39A
JA41A KA02 KB11 KB12
KB14 KB17 K019 KE1元
KE17R MA13 MA14 PB29
PB28 PC01
4D025 AA03 AA06 AA09 AB06 AB16
AB17 BA08 BA13 BA25 BA26
BB03 BB16 BB17 CA04 CA05
DA01 DA03 DA05 DA06
4D051 DA08 DB13 EA09 EB01 EB13
EB22 EB37 FA03 FA06 FA09

GA06